PRODUCTION OF NEAR-INFRARED ABSORPTIVE URETHANE RESIN

Patent Number:

JP8073732

Publication date:

1996-03-19

Inventor(s):

KANEMURA YOSHINOBU; NAGATA TERUYUKI; ITO NAOTO

Applicant(s):

MITSUI TOATSU CHEM INC

Requested Patent:

JP8073732

Application Number: JP19940214462 19940908

Priority Number(s):

IPC Classification:

C08L75/04; C08G18/32; C08G18/38; C08G18/73; C08K5/56

EC Classification:

Equivalents:

JP3328440B2

Abstract

PURPOSE: To obtain a near-infrared absorptive urethane resin which effectively absorbs a light of 1,000-1,100nm in wavelength by mixing and polymerizing a specified isocyanate compound, a specified active hydrogen compound and a near-infrared absorber.

CONSTITUTION: This resin is produced by polymerizing a mixture of at least one ester compound (A) selected from among isocyanates, isothiocyanates and isothiocyanato-containing isocyanates, at least one active hydrogen compound (B) selected from among polyols, polythiols and hydroxylated mercapto compounds, and a near-infrared absorber (C) represented by formula I [R1 to R10 ' are each independently H, alkyl, aryl, alkoky, etc.; M is a transition metal atom, an alkali (alkaline earth) metal atom, etc., and at least one of R1 to R10 and at least one of R1 ' to R10 ' have each a structure of formula II (R and R' are as defined in formula I)].

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-73732

(43)公開日 平成8年(1996)3月19日

三井東圧化学株式会社	(51) Int.Cl. ⁶	
18/38 NDQ 18/73 NFG C 0 8 K 5/56 審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 15 頁 (21)出願番号 特願平6-214462 (71)出願人 000003126 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目 2番 5 号 (72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	CO8L 75/0	
18/73 NFG TO 8 K 5/56 審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 15 頁 (21)出願番号 特願平6-214462 (71)出願人 000003126 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 (72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	C 0 8 G 18/3	
C08K 5/56 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 15 頁 (21)出願番号 特願平6-214462 (71)出願人 000003126 三井東圧化学株式会社東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 (72)発明者 金村 芳信福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	18/3	
審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 15 頁 (21)出願番号 特願平6-214462 (71)出願人 000003126 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目 2番 5 号 (72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	18/7	
(21)出願番号 特願平6-214462 (71)出願人 000003126 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 (72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	CO8K 5/5	
三井東圧化学株式会社 (22)出願日 平成6年(1994)9月8日 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 (72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東		
(22)出願日 平成6年(1994)9月8日 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 (72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	(21)出願番号 特願平6	
(72)発明者 金村 芳信 福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東		
福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東	(22)出顧日	
,		
化学株式会社内		
(72)発明者 永田 輝幸		
福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井東		
化学株式会社内	•	
(72)発明者 伊藤 尚登		
福岡県大牟田市正山町103番地		

(54) 【発明の名称】 近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法

(57)【要約】

【構成】 イソシアネート化合物、イソチオシアネート化合物及びイソチオシアナト基を有するイソシアネート化合物よりなる群より選ばれた少なくとも一種以上のエステル化合物と、ポリオール、ポリチオール及び水酸基を有するメルカプト化合物よりなる群より選ばれたすくなくとも一種以上の活性水素化合物と、近赤外線吸収剤とを混合した後重合することを特徴とする近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法。

【効果】 1000~1100nmの光を効果的に吸収する、近赤外線吸収ウレタン樹脂を得る事が出来る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 イソシアネート化合物、イソチオシアネート化合物及びイソチオシアナト基を有するイソシアネート化合物よりなる群より選ばれた少なくとも一種以上のエステル化合物と、ポリオール、ポリチオール及び水

酸基を有するメルカプト化合物よりなる群より選ばれた すくなくとも一種以上の活性水素化合物と、一般式 (1)

【化1】

$$-N \stackrel{R}{\underset{R'}{\setminus}}$$

[但し、式中、R1~R'10までは各々独立に、水素原 子、置換または未置換のアルキル基、アリール基、アル コキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリー ルチオ基、モノ又はジアルキルアミノ基、モノ又はジア 20 リールアミノ基を表し、かつ各基は連結基により環状に なっていてもよい。また、Mは遷移金属原子及びその誘 導体またはアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子、 III族及びIV族の原子及びその誘導体を表す。さら にR1~R10の内少なくとも一つは式(2)の構造を有 し、R'1~R'10の内少なくとも一つは式(2)の構 造を有する。但し式中、R及びR'は各々独立に、水素 原子、置換または未置換のアルキル基、アリール基、ア ルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、モノ又はジアルキルアミノ基、モノ又はジ 30 アリールアミノ基を表す。〕で表される近赤外線吸収剤 とを混合した後重合することを特徴とする近赤外線吸収 ウレタン樹脂の製造方法。

【請求項2】 請求項1のエステル化合物が、脂肪族イソシアネート及び/または脂環族イソシアネート化合物であることを特徴とする、請求項1の近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法。

【請求項3】 請求項2の脂肪族イソシアネート及び/ または脂環族イソシアネート化合物が、ヘキサメチレン ジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシ アネート、イソホロンジイソシアネート、ノルボルナン ビス(イソシアナトメチル)、ジシクロヘキシルメタン ジイソシアネートから選ばれた一種または二種以上であ ることを特徴とする、請求項2の近赤外線吸収ウレタン 樹脂の製造方法。

【請求項4】 請求項1の活性水素化合物が、ポリチオール及び/または水酸基を有するメルカプト化合物であることを特徴とする、請求項1の近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法。

【請求項5】 請求項4のポリチオールが、ペンタエリ 50

スリトールテトラキス (3ーメルカプトプロピオネート) であることを特徴とする、請求項4の近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法。

(2)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法に関する。更に詳しく述べると、近年近赤外光を利用する技術が注目されてきている、近赤外光の工業的応用としては、エネルギー変換材料、レーザー光を利用する記録材料、印刷及び写真材料、レーザー光を利用する精密加工、電子機器のコントロールシステム、太陽光の熱線遮断などに用いられる。このため、外部よりの近赤外光を遮断あるいは吸収する樹脂が必要となっている。本発明はこの分野に用いられる近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】前述のような用途に用いられる近赤外線 吸収ウレタン樹脂として、先に、本発明者らは特開昭 6 4-11153を開示した。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら特開昭64-11153に開示した近赤外線吸収ウレタン樹脂は吸収波長が $650\sim900$ nmであり、それよりもさらに長波長の光、つまり、 $1000\sim1100$ nmを効果的に吸収するものではなかった。そのため、 $1000\sim1100$ nmの光を効果的に吸収する近赤外線吸収ウレタン樹脂が求められていた。本発明は、 $1000\sim1100$ nmの光を効果的に吸収する近赤外線吸収ウレタン樹脂を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前記問題点 を解決するために鋭意検討を行った結果、ウレタン樹脂 原料に本発明の特定の近赤外線吸収剤を添加して重合し た場合、近赤外線吸収剤がジチオ金属錯体であるにもか かわらず、本発明の樹脂成分のエステル化合物と活性水素化合物の反応を阻害することなく、また該近赤外線吸収剤が分解されることなく重合反応が進み、1000~1100nmの波長域に吸収を有し、1000~1100nmの光を効果的に吸収する樹脂を与えることを見出し本発明に到達した。

【0005】すなわち、本発明はポリイソシアネート化合物、ポリイソチオシアネート化合物及びイソチオシアナト基を有するイソシアネート化合物よりなる群より選ばれた少なくとも一種以上のエステル化合物と、ポリオ

ール、ポリチオール及び水酸基を有するメルカプト化合物よりなる群より選ばれたすくなくとも一種以上の活性水素化合物と、一般式(1)で表される特定の近赤外線吸収剤を混合した後重合することを特徴とする近赤外線吸収ウレタン樹脂の製造方法である。本願発明に用いられる一般式(1)で表される近赤外線吸収剤は、具体的には

【0006】 【化2】

$$-N \stackrel{R}{\underset{R'}{\cdot}} \qquad \qquad (2)$$

(2)の構造を有し、R'1~R'10の内少なくとも一つは式(2)の構造を有する。但し式中、R及びR'は各々独立に、水素原子、置換または未置換のアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、モノ又はジアルキルアミノ基、モノ又はジアリールアミノ基を表す。〕で表されるジチオ金属錯体系近赤外線吸収剤である。

【0008】上記式R1~R'10で示される置換又は未置換のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、
n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、
40iso-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、
n-ペンチル基、iso-ペンチル基、neo-ペンチル基、1,2-ジメチルプロピル基、n-ヘキシル基、
cyclo-ヘキシル基、1,3-ジメチルブチル基、
1-iso-プロピルプロピル基、1,2-ジメチルブチル基、
1-iso-プロピルプロピル基、1,2-ジメチルブチル基、
2-メチルー1-iso-プロピルプロピル基、1
-エチルー3-メチルブチル基、n-オクチル基、2エチルヘキシル基、3-メチルー1-iso-プロピル
ブチル基、2-メチルー1-iso-プロピル

tーブチルー2ーメチルプロピル基、nーノニル基、等 の炭素数1~20の直鎖又は分岐のアルキル基、メトキ シメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プ ロポキシエチル基、プトキシエチル基、γーメトキシプ ロピル基、yーエトキシプロピル基、メトキシエトキシ エチル基、エトキシエトキシエチル基、ジメトキシメチ ル基、ジエトキシメチル基、ジメトキシエチル基、ジエ トキシエチル基等のアルコキシアルキル基、アルコキシ アルコキシアルキル基、アルコキシアルコキシアルコキ シアルキル基、クロロメチル基、2,2,2,ートリク ロロエチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2,-トリクロロエチル基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサ フルオロー2ープロピル基、などのハロゲン化アルキル 基、アルキルアミノアルキル基、ジアルキルアミノアル キル基、アルコキシカルボニルアルキル基、アルキルア ミノカルボニルアルキル基、アルコキシスルホニルアル キル基、アルキルスルホニル基などを表す。

【0009】 置換又は未置換のアルコキシ基の例としては、メトキシ基、エトキシ基、nープロピルオキシ基、isoープロピルオキシ基、、nープチルオキシ基、isoープチルオキシ基、secーブチルオキシ基、tーブチルオキシ基、nーペンチルオキシ基、isoーペンチルオキシ基、neoーペンチルオキシ基、1,2ージメチループロピルオキシ基、nーへキシルオキシ基、cycloーへキシルオキシ基、1,3ージメチルーブチルオキシ基、1-isoープロピルプロピルオキシ基、1,4ージメチルペンチルオキシ基、2ーメチルー1-isoープロピルプロピルオキシ基、1-エチルー

3-メチルブチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、2 ーエチルヘキシルオキシ基、3-メチル-1-iso-プロピルブチルオキシ基、2-メチル-1-iso-プ ロピルオキシ基、1-t-ブチル-2-メチルプロピル オキシ基、nーノニルオキシ基、等の炭素数1~20の 直鎖又は分岐のアルコキシ基、メトキシメトキシ基、メ トキシエトキシ基、エトキシエトキシ基、プロポキシエ トキシ基、ブトキシエトキシ基、ソーメトキシプロピル オキシ基、ソーエトキシプロピルオキシ基、メトキシエ トキシエトキシ基、エトキシエトキシエトキシ基、ジメ トキシメトキシ基、ジエトキシメトキシ基、ジメトキシ エトキシ基、ジエトキシエトキシ基等のアルコキシアル コキシ基、メトキシエトキシエトキシ基、エトキシエト キシエトキシ基、ブチルオキシエトキシエトキシ基など のアルコキシアルコキシアルコキシ基、アルコキシアル コキシアルコキシアルコキシ基、クロロメトキシ基、 2, 2, 2, -トリクロロエトキシ基、トリフルオロメ トキシ基、2,2,-トリクロロエトキシ基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2ープロピルオ キシ基、などのハロゲン化アルコキシ基、ジメチルアミ ノエトキシ基、ジエチルアミノエトキシ基などのアルキ ルアミノアルコキシ基、ジアルキルアミノアルコキシ基 などが挙げられる。

【0010】置換又は未置換のアリール基の例としては、フェニル基、クロロフェニル基、ジクロロフェニル基、ブロモフェニル基、フッ素化フェニル基、ヨウ素化フェニル基等のハロゲン化フェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、エチルフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、ピリジル基などが挙げられる。

【0011】置換又は未置換のアリールオキシ基の例としては、フェノキシ基、トリルオキシ基、メトキシフェニルオキシ基、クロロフェニルオキシ基、メジチルオキシ基、ナフトキシ基、アルキルフェノキシ基、等が挙げられる。

【0012】置換又は未置換のアルキルチオ基の例としては、メチルチオ基、エチルチオ基、nープロピルチオ基、isoープロピルチオ基、secーブチルチオ基、tーブチルチオ基、nーペンチルチオ基、isoーペンチルチオ基、nーペンチルチオ基、isoーペンチルチオ基、neoーペンチルチオ基、1,2ージメチループロピルチオ基、1,3ージメチループチルチオ基、1,3ージメチループチルチオ基、1,3ージメチループチルチオ基、1,2ージメチルプチル

6

チオ基、n-ヘプチルチオ基、1,4-ジメチルペンチ ルチオ基、2ーメチルー1ーisoープロピルプロピル チオ基、1-エチルー3-メチルブチルチオ基、n-オ クチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、3-メチル -1-iso-プロピルブチルチオ基、2-メチル-1 - i so-プロピルチオ基、1-t-ブチル-2-メチ ルプロピルチオ基、n-ノニルチオ基、等の炭素数1~ 20の直鎖又は分岐のアルキルチオ基、メトキシメチル チオ基、メトキシエチルチオ基、エトキシエチルチオ 基、プロポキシエチルチオ基、ブトキシエチルチオ基、 yーメトキシプロピルチオ基、yーエトキシプロピルチ オ基、メトキシエトキシエチルチオ基、エトキシエトキ シエチルチオ基、ジメトキシメチルチオ基、ジエトキシ メチルチオ基、ジメトキシエチルチオ基、ジエトキシエ チルチオ基等のアルコキシアルキルチオ基、アルコキシ アルコキシアルキルチオ基、アルコキシアルコキシアル コキシアルキルチオ基、クロロメチルチオ基、2.2. 2, ートリクロロエチルチオ基、トリフルオロメチルチ オ基、2,2,2,-トリクロロエチルチオ基、1, 1、1、3、3、3ーヘキサフルオロー2ープロピルチ オ基、などのハロゲン化アルキルチオ基、ジメチルアミ ノエチルチオ基、ジエチルアミノエチルチオ基などのア ルキルアミノアルキルチオ基、ジアルキルアミノアルキ ルチオ基などが挙げられる。

【0013】置換又は未置換のアリールチオ基の例としては、フェニルチオ基、トリルチオ基、クロロフェニルチオ基、メトキシフェニルチオ基、メシチルチオ基、ナフチルチオ基、アルキルフェニルチオ基、等が挙げられる。

【0014】置換又は未置換のモノ又はジアルキルアミノ基の例としては、メチルアミノ基、ジメチルアミノ 基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基、プロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、ブ チルアミノ基、ジブチルアミノ基、 β ーヒドロキシエチルアミノ基、ジー(β ーヒドロキシエチル)アミノ基、等が挙げられる。

【0015】置換又は未置換のモノ又はジアリールアミノ基の例としては、フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、クロロフェノ基、トリルアミノ基、メトキシフェニルアミノ基、等が挙げられる。各基が連結基により環状になってもよい場合の置換基としては、

[0016]

【化3】

【0017】〔上記式中、Rは置換又は未置換のアルキル基又は水素原子を表し、Y, Y'Y"は、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基を表す。〕等が挙げられる。

【0018】Mで示される原子としては、Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, R-Al, X-Al, R-Ga, X-Ga, In-R, In-X, R2Si, X2Si, R2Ge, X2Ge, R2Sn, X2Sn, Pb, Mn, Fe, Co, Ni, Co-X, Cu, Zn, Ru, Rh, Pd, VO等が挙げられる。〔但し、Rはアルキル基、アリール基、アルコキシ基を表し、XはF, Cl, Br, I, CN, SCNを表す。〕【0019】本願発明の特定の近赤外線吸収剤の添加量は吸収剤の種類、モノマーの組み合わせ、その他の添加剤によって異なるが、一般に原料組成物の全体量に対して10ppm以上である。添加量が10ppmより少ない場合は充分な吸収能が得られないことがあり好ましくない。

【0020】本発明に用いられるポリイソシアネート化 40 合物としては、例えば、エチレンジイソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、オクタメチレンジイソシアネート、ノナメチレンジイソシアネート、2,2'ージメチルペンタンジイソシアネート、2,2'4ートリメチルヘキサンメチレンジイソシアネート、デカメチレンジイソシアネート、ブテンジイソシアネート、デカメチレンジイソシアネート、1,3ーブタジエンー1,4ージイソシアネート、2,4,4ートリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、1,6,11ーウンデカトリイソシアネート、50

ト、1、3、6ーヘキサメチレントリイソシアネート、 1,8-ジイソシアナト-4-イソシアナトメチルオク タン、2、5、7ートリメチルー1、8ージイソシアナ トー5ーイソシアナトメチルオクタン、ビス(イソシア ナトエチル) カーボネート、ビス (イソシアナトエチ ル) エーテル、1, 4ーブチレングリコールジプロピル エーテルーω, ω' -ジイソシアネート、リジンジイソ シアナトメチルエステル、リジントリイソシアネート、 2ーイソシアナトエチルー2,6-ジイソシアナトヘキ サノエート、2ーイソシアナトプロピルー2,6ージイ ソシアナトヘキサノエート、キシリレンジイソシアネー ト、ビス(イソシアナトエチル)ベンゼン、ビス(イソ シアナトプロピル) ベンゼン、 α , α , α ', α ' ーテ トラメチルキシリレンジイソシアナート、ビス (イソシ アナトブチル) ベンゼン、ビス (イソシアナトメチル) ナフタリン、ビス (イソシアナトメチル) ジフェニルエ **ーテル、ビス(イソシアナトエチル)フタレート、メシ** チレントリイソシアネート、2,6-ジ(イソシアナト メチル)フラン等の脂肪族ポリイソシアネート、イソホ ロンジイソシアネート、ビス (イソシアナトメチル) シ クロヘキサン、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネー ト、シクロヘキサンジイソシアネート、メチルシクロヘ キサンジイソシアネート、ジシクロヘキシルジメチルメ タンジイソシアネート、2,2'ージメチルジシクロへ キシルメタンジイソシアネート、ピス(4ーイソシアナ トーnープチリデン) ペンタエリスリトール、ダイマ酸 ジイソシアネート、2ーイソシアナトメチルー3ー(3 ーイソシアナトプロピル) -5-イソシアナトメチルー ビシクロ〔2, 2, 1〕 ーヘプタン、2ーイソシアナト メチルー3ー(3ーイソシアナトプロピル)ー6ーイソ

シアナトメチルービシクロ〔2,2,1〕-ヘプタン、 2-イソシアナトメチル-2-(3-イソシアナトプロ ピル) -5-イソシアナトメチルービシクロ〔2, 2, 1] ーヘプタン、2ーイソシアナトメチルー2ー(3ー イソシアナトプロピル) - 6 - イソシアナトメチルービ シクロ〔2, 2, 1〕 ーヘプタン、2ーイソシアナトメ チルー3ー(3ーイソシアナトプロピル)-6-(2-イソシアナトエチル)ービシクロ〔2, 2, 1〕ーヘプ タン、2ーイソシアナトメチルー3ー(3ーイソシアナ トプロピル) -6-(2-イソシアナトエチル) -ビシ クロ〔2, 1, 1〕ーヘプタン、2ーイソシアナトメチ ルー2ー(3ーイソシアナトプロピル)-5-(2ーイ ソシアナトエチル)ービシクロ〔2, 2, 1〕ーヘプタ ン、2-イソシアナトメチル-2-(3-イソシアナト プロピル) -6-(2-イソシアナトエチル) -ビシク ロ〔2, 2, 1〕ーヘプタン、ノルボルナンビス(イソ シアナトメチル)等の脂環族ポリイソシアネート、フェ ニレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、 エチルフェニレンジイソシアネート、イソプロピレンフ ェニレンジイソシアネート、ジメチルフェニレンジイソ 20 シアネート、ジエチルフェニレンジイソシアネート、ジ イソプロピルフェニレンジイソシアネート、トリメチル ベンゼントリイソシアネート、ベンゼントリイソシアネ ート、ナフタリンジイソシアネート、メチルナフタレン ジイソシアネート、ビフェニルジイソシアネート、トリ ジンジイソシアネート、4,4'ージフェニルメタンジ イソシアネート、3,3'ージメチルジフェニルメタン -4, 4'-ジイソシアネート、ビベンジルー4, 4' ージイソシアネート、ビス(イソシアナトフェニル)エ チレン、3, 3'ージメトキシビフェニルー4, 4'ー 30 ジイソシアネート、トリフェニルメタントリイソシアネ ート、ポリメリックMDI、ナフタリントリイソシアネ ート、ジフェニルメタンー2、4、4'ートリイソシア ネート、3ーメチルジフェニルメタンー4, 6, 4'ー トリイソシアネート、4ーメチルージフェニルメタンー 3. 5. 2'. 4'. 6'ーペンタイソシアネート、フ ェニルイソシアナトメチルイソシアネート、フェニルイ ソシアナトエチルエチルイソシアネート、テトラヒドロ ナフチレンジイソシアネート、ヘキサヒドロベンゼンジ イソシアネート、ヘキサヒドロジフェニルメタンー4. 4'ージイソシアネート、ジフェニルエーテルジイソシ アネート、エチレングリコールジフェニルエーテルジイ ソシアネート、1,3-プロピレングリコールジフェニ ルエーテルジイソシアネート、ベンゾフェノンジイソシ アネート、ジエチレングリコールジフェニルエーテルジ イソシアネート、ジベンゾフランジイソシアネート、カ ルパゾールジイソシアネート、エチルカルバゾールジイ ソシアネート、ジクロロカルバゾールジイソシアネート 等の芳香族ポリイソシアネート、チオジエチルジイソシ アネート、チオジプロピルジイソシアネート、チオジへ 50 キシルジイソシアネート、ジメチルスルフォンジイソシ アネート、ジチオジメチルジイソシアネート、ジチオジ エチルジイソシアネート、ジチオジプロピルジイソシア ネート、ジシクロヘキシルスルフィドー4.4'ージイ ソシアネート等の含硫脂肪族イソシアネート、ジフェニ ルスルフィドー2, 4'ージイソシアネート、ジフェニ ルスルフィドー4, 4'ージイソシアネート、3, 3' ージメトキシー 4, 4'ージイソシアナトジベンジルチ オエーテル、ビス (4ーイソシアナトメチルベンゼン) スルフィド、4、4'ーメトキシベンゼンチオエチレン グリコールー3、3'ージイソシアネートなどの芳香族 スルフィド系イソシアネート、ジフェニルジスルフィド -4,4'-ジイソシアネート、2,2'-ジメチルジ フェニルジスルフィドー5,5'ージイソシアネート、 3. 3'ージメチルジフェニルジスルフィドー5. 5' ージイソシアネート、3,3'ージメチルジフェニルジ スルフィドー6、6'ージイソシアネート、4、4'ー ジメチルジフェニルジスルフィドー5,5'ージイソシ アネート、3, 3'ージメトキシジフェニルジスルフィ ドー4、4'ージイソシアネート、4、4'ージメトキ シジフェニルジスルフィドー3,3'ージイソシアネー トなどの芳香族ジスルフィド系イソシアネート、ジフェ ニルスルホンー4, 4'ージイソシアネート、ジフェニ ルスルホンー3, 3'ージイソシアネート、ベンジディ ンスルホンー4, 4'ージイソシアネート、ジフェニル メタンスルホンー4、4'ージイソシアネート、4ーメ チルジフェニルメタンスルホンー2、4'ージイソシア ネート、4, 4'ージメトキシジフェニルスルホンー 3, 3'ージイソシアネート、3, 3'ージメトキシー 4, 4'ージイソシアネートジベンジルスルホン、4, 4'ージメチルジフェニルスルホンー3,3'ージイソ シアネート、4, 4'ージーtertーブチルジフェニ ルスルホンー3, 3'ージイソシアネート、4, 4'ー メトキシベンゼンエチレンジスルホンー3,3'ージイ ソシアネート、4, 4'ージクロロジフェニルスルホン -3.3'ージイソシアネートなどの芳香族スルホン系 イソシアネート、4ーメチルー3ーイソシアナトベンゼ ンスルホニルー4'ーイソシアナトフェノールエステ ル、4-メトキシー3-イソシアナトベンゼンスルホニ ルー4'ーイソシアナトフェノールエステルなどのスル ホン酸エステル系イソシアネート、4-メチル-3-イ ソシアナトベンゼンスルホニルアニリドー3'ーメチル -4'-イソシアネート、ジベンゼンスルホニルーエチ レンジアミンー4, 4'ージイソシアネート、4, 4' ーメトキシベンゼンスルホニルーエチレンジアミンー 3. 3'ージイソシアネート、4ーメチルー3ーイソシ アナトベンゼンスルホニルアニリドー4ーメチルー3' ーイソシアネートなどの芳香族スルホン酸アミド、チオ フェンー2, 5ージイソシアネート、チオフェンー2, 5-ジイソシアナトメチル、1,4-ジチアン-2,5

ージイソシアネート、1,4ージチアンー2,5ージイソシアナトメチル等の含硫複素環化合物などが挙げられる。

【0021】またこれらの塩素置換体、臭素置換体等のハロゲン置換体、アルキル置換体、アルコキシ置換体、ニトロ置換体や、多価アルコールとのプレポリマー型変性体、カルボジイミド変性体、ウレア変性体、ビュレット変性体、ダイマー化あるいはトリマー化反応生成物等もまた使用できる。

【0022】本発明において用いられるポリイソチオシ アネート化合物は、一分子中に-NCS基を2つ以上含 有する化合物であり、さらにイソチオシアナト基の他に 硫黄原子を含有していてもよい。具体的には、例えば、 1, 2-ジイソチオシアナトエタン、1, 3-イソチオ シアナトプロパン、1, 4-ジイソチオシアナトブタ ン、1、6-ジイソチオシアナトヘキサン、p-フェニ レンジイソプロピリデンジイソチオシアネート等の脂肪 族イソチオシアネート、シクロヘキサンジイソチオシア ネート等の脂環族イソチオシアネート、1,2-ジイソ チオシアナトベンゼン、1,3-ジイソチオシアナトベ20 ンゼン、1, 4-ジイソチオシアナトベンゼン、2, 4 ージイソチオシアナトトルエン、2,5-ジイソチオシ アナトーnーキシレン、4,4'ージイソチオシアナト -1, 1'-ビフェニル、1, 1'-メチレンビス(4 ーイソチオシアナトベンゼン)、1,1'ーメチレンビ ス(4-イソチオシアナト-2-メチルベンゼン)、 1, 1'ーメチレンビス(4ーイソチオシアナトー3ー メチルベンゼン)、1,1'-(1,2-エタンジイ ル) ビス(4ーイソチオシアナトベンゼン)、4.4' ージイソチオシアナトベンゾフェノン、4,4'ージイ 30 ソチオシアナトー3,3'ージメチルベンゾフェノン、 ベンズアニリドー3, 4'ージイソチオシアネート、ジ フェニルエーテルー4, 4'ージイソチオシアネート、 ジフェニルアミンー4、4'ージイソチオシアネート等 の芳香族イソチオシアネート、2, 4, 6-トリイソチ オシアナトー1, 3, 5ートリアジン等の複素環含有イ ソチオシアネート、さらにはヘキサンジオイルジイソチ オシアネート、ノナンジオイルジイソチオシアネート、 カルボニックジイソチオシアネート、1、3-ベンゼン ジカルボニルジイソチオシアネート、1, 4ーベンゼン 40 ジカルボニルジイソチオシアネート、(2, 2'ーピピ リジン) -4, 4' -ジカルボニルジイソチオシアネー ト等のカルボニルイソチオシアネートが挙げられる。

【0023】本発明に於いて原料として用いるイソチオシアナト基の他に1つ以上の硫黄原子を有する2官能以上のポリイソチオシアネートとしては、例えば、チオビス(3-イソチオシアナトプロパン)、チオビス(2-イソチオシアナトエタン)、ジチオビス(2-イソチオシアナトエタン)等の含硫脂肪族イソチオシアネート、1-イソチオシアナト-4-{(2-イソチオシアナ

ト)スルホニル〉ベンゼン、チオビス(4ーイソチオシアナトベンゼン)、スルホニルビス(4ーイソチオシアナトベンゼン)、スルフィニルビス(4ーイソチオシアナトベンゼン)、ジチオビス(4ーイソチオシアナトベンゼン)、4ーイソチオシアナトー1ー((4ーイソチオシアナトフェニル)スルホニル〉ー2ーメトキシーベンゼン、4ーメチルー3ーイソチオシアナトベンゼンスルホニルー4'ーイソチオシアナトベンゼンスルホニルー2・イソチオシアナトベンゼンスルホニルアニリドー3'ーメチルー4'ーイソチオシアネートなどの含硫芳香族イソチオシアネート、チオフェノンー2、5ージイソチオシアネート、1、4ージチアンー2、5ージイソチオシアネートなどの含硫複素環化合物が挙げられる。

12 -

【0024】さらに、これらのポリイソチオシアネートの塩素置換体、臭素置換体等のハロゲン置換体、アルキル置換体、アルコキシ置換体、ニトロ置換体や、多価アルコールとのプレポリマー型変性体、カルボジイミド変性体、ウレア変性体、ビュレット変性体、ダイマー化あるいはトリマー化反応生成物等もまた使用できる。

【0025】本発明に於いて原料として用いるイソチオ シアナト基を有するイソシアネート化合物としては、例 えば、1-イソチオシアナト-3-イソシアナトプロパ ン、1-イソチオシアナト-5-イソシアナトペンタ ン、1ーイソチオシアナトー6ーイソシアナトヘキサ ン、イソチオシアナトカルボニルイソシアネート、1-イソチオシアナトー4ーイソシアナトシクロヘキサンな どの脂肪族あるいは脂環族化合物、1-イソチオシアナ トー4ーイソシアナトベンゼン、4ーメチルー3ーイソ チオシアナトー1ーイソシアナトベンゼンなどの芳香族 化合物、2ーイソチオシアナトー4,5ージイソシアナ トー1, 3, 5ートリアジンなどの複素環式化合物、さ らには4-イソシアナト-4'-イソチオシアナトジフ ェニルスルフィド、2ーイソシアナト-2'-イソチオ シアナトジエチルジスルフィド等のイソチオシアナト基 以外にも硫黄原子を含有する化合物が挙げられる。

【0026】さらに、これら化合物の塩素置換体、臭素 置換体等のハロゲン置換体、アルキル置換体、アルコキ シ置換体、ニトロ置換体、多価アルコールとのプレポリ マー型変性体、カルボジイミド変性体、ウレア変性体、 ビュレット変性体、ダイマー化あるいはトリマー化反応 生成物等もまた使用できる。これらエステル化合物はそ れぞれ単独で用いることも、また二種類以上を混合して 用いてもよい。

【0027】これらのエステル化合物のうち、入手のし易さ、近赤外線吸収剤の安定性の面から、脂肪族イソシアネート及び脂環族イソシアネートが好ましく使用され、それらの中でも、ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ノルボルナンビス(イソシア

ナトメチル)、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネー トが好ましく使用される。

【0028】本発明に用られる活性水素化合物として は、例えば以下が挙げられる。ポリオールとしては、エ チレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレ ングリコール、テトラエチレングリコール、プロピレン グリコール、ジプロピレングリコール、ブチレングリコ ール、ネオペンチルグリコール、グリセリン、トリメチ ロールエタン、トリメチロールプロパン、ブタントリオ ール、1,2ーメチルグルコサイド、ペンタエリスリト ール、ジペンタエリスリトール、トリペンタエリスリト ール、ソルビトール、エリスリトール、スレイトール、 リビトール、アラビニトール、キシリトール、アリトー ル、マニトール、ドルシトール、イディトール、グリコ ール、イノシトール、ヘキサントリオール、トリグリセ ロース、ジグリペロール、トリエチレングリコール、ポ リエチレングリコール、トリス(2ーヒドロキシエチ ル) イソシアヌレート、シクロブタンジオール、シクロ ペンタンジオール、シクロヘキサンジオール、シクロヘ プタンジオール、シクロオクタンジオール、シクロヘキ サンジメタノール、ヒドロキシプロピルシクロヘキサノ ール、トリシクロ〔5, 2, 1, 0, 2, 6〕 デカンー ジメタノール、ビシクロ〔4,3,0〕 ーノナンジオー ル、ジシクロヘキサンジオール、トリシクロ〔5,3, 1, 1] ドデカンジオール、ビシクロ〔4, 3, 0〕 ノ ナンジメタノール、トリシクロ〔5,3,1,1〕ドデ カンージエタノール、ヒドロキシプロピルトリシクロ [5, 3, 1, 1] ドデカノール、スピロ[3, 4] オ クタンジオール、ブチルシクロヘキサンジオール、1, 1'ービシクロヘキシリデンジオール、シクロヘキサン トリオール、マルチトール、ラクチトール等の脂肪族ポ リオール、ジヒドロキシナフタレン、トリヒドロキシナ フタレン、テトラヒドロキシナフタレン、ジヒドロキシ ベンゼン、ベンゼントリオール、ビフェニルテトラオー ル、ピロガロール、(ヒドロキシナフチル)ピロガロー ル、トリヒドロキシフェナントレン、ビスフェノール A、ビスフェノールF、キシリレングリコール、ジ(2 ーヒドロキシエトキシ) ベンゼン、ビスフェノール A ー ビスー(2-ヒドロキシエチルエーテル)、テトラブロ ムビスフェノールA、テトラプロムビスフェノールAー ビスー (2ーヒドロキシエチルエーテル) 等の芳香族ポ リオール、ジプロモネオペンチルグリコール等のハロゲ ン化ポリオール、エポキシ樹脂等の高分子ポリオールの 他にシュウ酸、グルタミン酸、アジピン酸、酢酸、プロ ピオン酸、シクロヘキサンカルボン酸、βーオキソシク ロヘキサンプロピオン酸、ダイマー酸、フタル酸、イソ フタル酸、サリチル酸、3-プロモプロピオン酸、2-プロモグリコール、ジカルボキシシクロヘキサン、ピロ メリット酸、ブタンテトラカルボン酸、プロモフタル酸 などの有機酸と前記ポリオールとの縮合反応生成物、前 50

記ポリオールとエチレンオキサイドやプロピレンオキサ イドなどアルキレンオキサイドとの付加反応生成物、ア ルキレンポリアミンとエチレンオキサイドや、プロピレ ンオキサイドなどアルキレンオキサイドとの付加反応生 成物、さらには、ビスー〔4-(ヒドロキシエトキシ) フェニル〕スルフィド、ビスー〔4-(2-ヒドロキシ プロポキシ)フェニル]スルフィド、ビスー〔4-(2, 3-ジヒドロキシプロポキシ)フェニル)スルフ ィド、ビスー〔4ー(4ーヒドロキシシクロヘキシロキ シ) フェニル) スルフィド、ビスー〔2-メチルー4-(ヒドロキシエトキシ) -6-ブチルフェニル] スルフ ィドおよびこれらの化合物に水酸基当たり平均3分子以 下のエチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシ ドが付加された化合物、ジー(2-ヒドロキシエチル) スルフィド、1,2-ビスー(2-ヒドロキシエチルメ ルカプト) エタン、ビス(2-ヒドロキシエチル) ジス ルフィド、1,4-ジチアン-2,5-ジオール、ビス (2, 3-ジヒドロキシプロピル)スルフィド、テトラ キス(4-ヒドロキシー2-チアプチル)メタン、ビス (4-ヒドロキシフェニル) スルホン(商品名ピスフェ **ノールS)、テトラプロモビスフェノールS、テトラメ** チルビスフェノールS、4,4'ーチオビス(6-te rtープチルー3ーメチルフェノール)、3.6ーヂチ アオクタンー1,8ージオール、1,3ービス(2ーヒ ドロキシエチルチオエチル) ーシクロヘキサンなどの硫

14

【0029】また、ポリチオールとしては、例えば、メ タンジチオール、1,2-エタンジチオール、1,1-プロパンジチオール、1,2-プロパンジチオール、 1, 3ープロパンジチオール、2, 2ープロパンジチオ ール、1,6-ヘキサンジチオール、1,2,3-プロ パントリチオール、テトラキス(メルカプトメチル)メ タン、1、1-シクロヘキサンジチオール、1、2-シ クロヘキサンジチオール、2、2ージメチルプロパンー 1, 3ージチオール、3, 4ージメトキシブタンー1, 2-ジチオール、3,6-ジオキサオクタン-1,8-ジメルカプタン、2-メチルシクロヘキサン-2,3-ジチオール、ビシクロ〔2, 2, 1〕ペプターexocis-2, 3-ジチオール、1, 1-ビス(メルカプトメチル) シクロヘキサン、チオリンゴ酸ビス(2-メ ルカプトエチルエステル)、2,3-ジメルカプトコハ ク酸(2-メルカプトエチルエステル)、2,3-ジメ ルカプトー1ープロパノール(2ーメルカプトアセテー ト)、2、3-ジメルカプト-1-プロパノール(3-メルカプトアセテート)、ジエチレングリコールビス (2-メルカプトアセテート)、ジエチレングリコール ビス(3-メルカプトプロピオネート)、1,2-ジメ ルカプトプロピルメチルエーテル、2,3-ジメルカプ トプロピルメチルエーテル、2,2-ビス(メルカプト メチル) -1, 3-プロパンジチオール、ビス(2-メ

黄原子を含有したポリオール等が挙げられる。

ルカプトエチル) エーテル、エチレングリコールビス (2-メルカプトアセテート)、エチレングリコールビ ス(3-メルカプトプロピオネート)、トリメチロール プロパントリス(2ーメルカプトアセテート)、トリメ チロールプロパントリス(3-メルカプトプロピオネー ト)、ペンタエリスリトールテトラキス(2-メルカプ トアセテート)、ペンタエリスリトールテトラキス(3 ーメルカプトプロピオネート)、1,2-ビス(2-メ ルカプトエチルチオ) -3-メルカプトプロパン) 等の 脂肪族ポリチオール、1,2-ジメルカプトベンゼン、 1, 3ージメルカプトベンゼン、1, 4ージメルカプト ベンゼン、1, 2ービス (メルカプトメチル) ベンゼ ン、1,3-ビス(メルカプトメチル)ベンゼン、1, 4-ビス(メルカプトメチル)ベンゼン、1,2-ビス (メルカプトエチル) ベンゼン、1,3-ビス(メルカ プトエチル) ベンゼン、1, 4-ビス (メルカプトエチ ル) ベンゼン、1,2-ビス(メルカプトメチレンオキ シ) ベンゼン、1, 3-ビス (メルカプトメチレンオキ シ) ベンゼン、1、4ービス (メルカプトメチレンオキ シ) ベンゼン、1, 2ービス (メルカプトエチレンオキ 20 シ) ベンゼン、1, 3-ビス (メルカプトエチレンオキ シ) ベンゼン、 1, 4-ビス (メルカプトエチレンオ キシ) ベンゼン、1, 2, 3-トリメルカプトベンゼ ン、1, 2, 4ートリメルカプトベンゼン、1, 3, 5 ートリメルカプトベンゼン、1,2,3ートリス(メル カプトメチル) ベンゼン、1, 2, 4ートリス (メルカ プトメチル) ベンゼン、1,3,5-トリス (メルカプ トメチル) ベンゼン、1,2,3-トリス(メルカプト エチル) ベンゼン、1、2、4-トリス(メルカプトエ チル) ベンゼン、1,3,5-トリス (メルカプトエチ 30 ル) ベンゼン、1, 2, 3-トリス (メルカプトメチレ ンオキシ) ベンゼン、1, 2, 4ートリス (メルカプト メチレンオキシ) ベンゼン、1,3,5-トリス (メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、1, 2, 3-トリス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1, 2, 4-トリス(メルカプトエチレンオキシ)ベンゼン、1. 3, 5ートリス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼ ン、1, 2, 3, 4ーテトラメルカプトベンゼン、1, 2, 3, 5ーテトラメルカプトベンゼン、1, 2, 4, 5ーテトラメルカプトベンゼン、1, 2, 3, 4ーテト ラキス(メルカプトメチル)ベンゼン、1,2,3,5 ーテトラキス(メルカプトメチル)ベンゼン、1,2, 4, 5-テトラキス (メルカプトメチル) ベンゼン、 1, 2, 3, 4ーテトラキス (メルカプトエチル) ベン ゼン、1, 2, 3, 5ーテトラキス (メルカプトエチ ル) ベンゼン、1, 2, 4, 5-テトラキス (メルカプ トエチル) ベンゼン、1, 2, 3, 4ーテトラキス (メ ルカプトエチル) ベンゼン、1, 2, 3, 5-テトラキ ス(メルカプトメチレンオキシ)ベンゼン、1.2. 4, 5ーテトラキス (メルカプトメチレンオキシ) ベン 50

ゼン、1, 2, 3, 4ーテトラキス (メルカプトエチレ ンオキシ) ベンゼン、1,2,3,5-テトラキス(メ ルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,4,5-テトラキス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、 2, 2'ージメルカプトビフェニル、4, 4'ージメル カプトビフェニル、4,4'ージメルカプトビベンジ ル、2、5ートルエンジチオール3、4ートルエンジチ オール、1,4ーナフタレンジチオール、1,5ーナフ タレンジチオール、2,6-ナフタレンジチオール、 2, 7ーナフタレンジチオール、2, 4ージメチルベン ゼン-1, 3-ジチオール、4, 5-ジメチルベンゼン -1, 3-ジチオール、9, 10-アントラセンジメタ ンチオール、1,3-ジ(p-メトキシフェニル)プロ パンー2, 2ージチオール、1, 3ージフェニルプロパ ンー2, 2ージチオール、フェニルメタンー1, 1ージ チオール、2, 4ージ(pーメルカプトフェニル)ペン タン等の芳香族ポリチオール、また、2,5-ジクロロ ベンゼンー1, 3-ジチオール、1, 3-ジ(p-クロ ロフェニル)プロパンー2,2ージチオール、3,4, 5ートリプロムー1, 2ージメルカプトベンゼン、2, 3, 4, 6ーテトラクロルー1, 5ーピス (メルカプト メチル)ベンゼン等の塩素置換体、臭素置換体等のハロ ゲン置換芳香族ポリチオール、また、2-メチルアミノ - 4, 6 ージチオールー s y mートリアジン、2 ーエチ ルアミノー4, 6ージチオールーsymートリアジン、 2ーアミノー4, 6ージチオールーsymートリアジ ン、2ーモルホリノー4,6-ジチオール-sym-ト リアジン、2-シクロヘキシルアミノ-4、6-ジチオ ールーsymートリアジン、2ーメトキシー4,6ージ チオールーs ymートリアジン、2ーフェノキシー4, 6 ージチオールー s y mートリアジン、2 ーチオベンゼ ンオキシー4,6ージチオールーsymートリアジン、 2-チオブチルオキシー4, 6-ジチオール-sym-トリアジン等の複素環を含有したポリチオール、さらに は1、2-ビス(メルカプトメチルチオ)ベンゼン、 1, 3-ビス(メルカプトメチルチオ)ベンゼン、1. 4ービス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1,2-ビス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1、3ービス (メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1, 4-ビス (メ ルカプトエチルチオ) ベンゼン、1, 2, 3-トリス (メルメルカプトメチルチオ) ベンゼン、1、2、4-トリス (メルメルカプトメチルチオ) ベンゼン、1. 3, 5ートリス (メルメルカプトメチルチオ) ベンゼ ン、1、2、3ートリス(メルカプトエチルチオ)ベン ゼン、1, 2, 4ートリス (メルカプトエチルチオ) ベ ンゼン、1、3、5ートリス(メルカプトエチルチオ) ベンゼン、1, 2, 3, 4ーテトラキス (メルカプトメ チルチオ) ベンゼン、1,2,3,5-テトラキス(メ ルカプトメチルチオ) ベンゼン、1, 2, 4, 5ーテト ラキス (メルカプトメチルチオ) ベンゼン、1, 2,

3. 4ーテトラキス (メルカプトエチルチオ) ベンゼ ン、1,2,3,5ーテトラキス(メルカプトエチルチ オ) ベンゼン、1, 2, 4, 5-テトラキス (メルカプ トエチルチオ)ベンゼン等、及びこれらの核アルキル化 物等のメルカプト基以外に硫黄原子を含有する芳香族ポ リチオール、ビス (メルカプトメチル) スルフィド、ビ ス (メルカプトエチル) スルフィド、ビス (メルカプト プロピル)スルフィド、ビス(メルカプトメチルチオ) メタン、ビス(2-メルカプトエチルチオ)メタン、ビ ス(3ーメルカプトプロピル)メタン、1.2ービス (メルカプトメチルチオ) エタン、1, 2-(2-メル カプトエチルチオ) エタン、1, 2-(3-メルカプト プロピル) エタン、1、3-ビス (メルカプトメチルチ オ)プロパン、1,3-ビス(2-メルカプトエチルチ オ)プロパン、1,3-ビス(3-メルカプトプロピル チオ)プロパン、1,2-ビス(2-メルカプトエチル チオ) -3-メルカプトプロパン、2-メルカプトエチ ルチオー1, 3ープロパンジチオール、1, 2, 3ート リス (メルカプトメチルチオ) プロパン、1,2,3-トリス(2-メルカプトエチルチオ)プロパン、1. 2、3ートリス(3ーメルカプトプロピルチオ)プロパ ン、テトラキス(メルカプトメチルチオメチル)メタ ン、テトラキス(2-メルカプトエチルチオメチル)メ タン、テトラキス(3-メルカプトプロピルチオメチ ル) メタン、ビス(2,3-ジメルカプトプロピル)ス ルフィド、2, 5ージメルカプトー1, 4ージチアン、 ビス (メルカプトメチル) ジスルフィド、ビス (メルカ プトエチル) ジスルフィド、ビス (メルカプトプロピ ル) ジスルフィド等、及びこれらのチオグリコール酸及 びメルカプトプロピオン酸のエステル、ヒドロキシメチ ルスルフィドビス(2-メルカプトアセテート)、ヒド ロキシメチルスルフィドビス (3-メルカプトプロピオ ネート)、ヒドロキシエチルスルフィドビス(2ーメル カプトアセテート)、ヒドロキシエチルスルフィドビス (3-メルカプトプロピオネート)、ヒドロキシプロピ ルスルフィドビス(2-メルカプトアセテート)、ヒド ロキシプロピルスルフィドビス(3ーメルカプトプロピ オネート)、ヒドロキシメチルジスルフィドビス(2-メルカプトアセテート)、ヒドロキシメチルジスルフィ ドビス (3-メルカプトプロピオネート)、ヒドロキシ 40 エチルジスルフィドビス (2-メルカプトアセテー ト)、ヒドロキシエチルジスルフィドビス(3-メルカ プトプロピオネート)、ヒドロキシプロピルジスルフィ ドビス(2-メルカプトアセテート)、ヒドロキシプロ ピルジスルフィドビス (3-メルカプトプロピオネー ト)、2-メルカプトエチルエーテルビス(2-メルカ プトアセテート)、2-メルカプトエチルエーテルビス (3-メルカプトプロピオネート)、1,4-ジチアン -2,5-ジオールビス(2-メルカプトアセテー ト)、1,4-ジチアン-2,5-ジオールビス(3-

メルカプトプロピオネート)、チオグリコール酸ビス (2-メルカプトエチルエステル)、チオジプロピオン 酸ビス(2ーメルカプトエチルエステル)、4,4ーチ オジブチル酸ビス(2-メルカプトエチルエステル)、 ジチオジグリコール酸ビス(2-メルカプトエチルエス テル)、ジチオジプロピオン酸ビス(2-メルカプトエ チルエステル)、4、4-ジチオジブチル酸ビス(2-) メルカプトエチルエステル)、チオジグリコール酸ビス (2, 3-ジメルカプトプロピルエステル)、チオジプ ロピオン酸ビス(2,3-ジメルカプトプロピルエステ ル)、ジチオグリコール酸ビス(2,3-ジメルカプト プロピルエステル)、ジチオジプロピオン酸(2,3-ジメルカプトプロピルエステル) 等のメルカプト基以外 に硫黄原子を含有する脂肪族ポリチオール、3,4ーチ オフェンジチオール、2,5ージメルカプトー1,3, 4ーチアジアゾール、2,5ージメルカプトー1,4-ジチアン、2,5ージメルカプトメチルー1,4ージチ アン等のメルカプト基以外に硫黄原子を含有する複素環 化合物等が挙げられる。

【0030】また、ヒドロキシ基を有するメルカプト化 合物としては、例えば、2-メルカプトエタノール、3 ーメルカプトー1, 2ープロパンジオール、グルセリン ジ(メルカプトアセテート)、1-ヒドロキシー4-メ ルカプトシクロヘキサン、2,4-ジメルカプトフェノ ール、2ーメルカプトハイドロキノン、4ーメルカプト フェノール、1,3ージメルカプトー2ープロパノー ル、2、3ージメルカプトー1ープロパノール、1、2 ージメルカプトー1, 3ーブタンジオール、ペンタエリ スリトールトリス(3-メルカプトプロピオネート)、 ペンタエリスリトールモノ (3-メルカプトプロピオネ ート)、ペンタエリスリトールビス(3 ーメルカプトプ ロピオネート)、ペンタエリスリトールトリス(チオグ リコレート)、ペンタエリスリトールペンタキス(3-メルカプトプロピオネート)、ヒドロキシメチルートリ ス(メルカプトエチルチオメチル)メタン、1-ヒドロ キシエチルチオー3ーメルカプトエチルチオベンゼン、 4ーヒドロキシー4'ーメルカプトジフェニルスルホ ン、2-(2-メルカプトエチルチオ)エタノール、ジ ヒドロキシエチルスルフィドモノ (3-メルカプトプロ ピオネート)、ジメルカプトエタンモノ(サルチレー ト)、ヒドロキシエチルチオメチルートリス(メルカプ トエチルチオ)メタン等が挙げられる。

【0031】さらには、これら活性水素化合物の塩素置換体、臭素置換体のハロゲン置換体を使用してもよい。 これらはそれぞれ単独で用いることも、また2種類以上 を混合して用いてもよい。

【0032】前記のエステル化合物と活性水素化合物との配合比率は、官能基モル比(NCO+NCS)/(SH+OH)で0.5~3.0の範囲内が好ましく、0.5~1.5の範囲内であれば更に好ましい。0.5未満

及び3.0を越えてもできなくもないが、得られる樹脂 の耐熱性が損なわれる場合があり、好ましくない結果を 与える事がある。

【0033】本発明の近赤外線吸収樹脂はウレタン系樹脂を素材とするものであり、イソ(チオ)シアナト基と活性水素基によるウレタン結合を主体とするが、目的によっては、それ以外にアロハネート結合、ウレヤ結合、チオウレヤ結合、ビュウレット結合等を含有しても、勿論差し支えない。

【0034】例えば、ウレタン結合にさらにイソシアナ 10 ト基を反応させたり、ジチオウレタン結合にさらにイソチオシアナト基を反応させて架橋密度を増大させることは好ましい結果を与える場合が多い。この場合には反応速度を少なくとも100℃以上に高くし、イソシアナート成分又はイソチオシアナート成分を多く使用する。あるいはまた、アミン等を一部併用し、ウレヤ結合、ビウレット結合を利用することもできる。このようにイソ(チオ)シアナート化合物と反応する前記活性水素化合物以外のものを使用する場合には、特に着色の点に留意する必要がある。 20

【0035】また目的に応じて公知の成形法におけると同様に、内部離型剤、鎖延長剤、架橋剤、光安定剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、油溶染料、充填剤などの種々の物質を添加してもよい。

【0036】所望の反応速度に調整するために、ポリウレタンの製造において用いられる公知の反応触媒を適宜に添加することもできる。

【0037】本発明の樹脂は、通常、注型重合により得られる。具体的には、エステル化合物と活性水素化合物の混合物に、一般式(1)で表される近赤外線吸収剤の30一種以上を混合する。その際、必要に応じて重合触媒、内部離型剤、紫外線吸収剤などの各種添加剤を適宜加えてもよい。この混合液を必要に応じ適当な方法で脱泡を

行なった後、モールド中に注入し、通常、0~50℃程度の低温から100~180℃程度の高温に徐々に昇温しながら重合させる。この際、重合後の離型性を容易にするため、モールドに公知の離型処理を施しても差し支えない。重合に要する時間は、モノマーの組み合わせ、添加剤の種類、量によって異なるが、通常2~48時間である。

【0038】本発明に係るウレタン系樹脂は、必要に応じ反射防止、高硬度付与、耐磨耗性向上、耐薬品性向上、防優性付与、あるいはファッション性付与等の改良を行なうため、表面研磨、帯電防止処理、ハードコート処理、無反射コート処理、染色処理、調光処理等の物理的あるいは化学処理を施すことができる。このようにして得られる近赤外線吸収樹脂は、1000~1100nmの波長域に吸収を有し、1000~1100nmの光を効果的に吸収するためYAGレーザーの保護板として有用である。

【0039】さらに、本発明の、一般式(1)で表される近赤外線吸収剤と特開昭64-11153に例示されたナフタロシアニン、フタロシアニン、アントラキノン系近赤外線吸収剤を併用することにより、650~1100nmの広い液長域に吸収を有する近赤外線吸収ウレタン系樹脂を製造することも出来る。

[0040]

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例により具体的に説明するが、本発明はこの実施例によって何ら制限されるものではない。

【0041】実施例1

ヘキサメチレンジイソシアネート100部、ペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネート)145部、及び下記の構造式(A)

[0042]

に応じ適当な方法で脱泡を 【化4】

SNISNICH3

CH3 N CH3 N CH3

で表される近赤外線吸収剤 0.061部とジブチル錫ジクロライド 0.12部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々に昇温しながら24時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得られた樹脂の吸収スペクトルを分光光度計(島津 UV-3100PC)で測定したところ図1のようであり、1000~1100nmに吸収を有していた。

【0043】実施例2

イソホロンジイソシアネート100部、ペンタエリスリトールテトラキス(3ーメルカプトプロピオネート)110部、及び構造式(A)で表される近赤外線吸収剤0.053部とジブチル錫ジクロライド0.84部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々に昇温しなが524時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得られた樹脂の吸収波長は1000~1100nmであった。

0 【0044】実施例3

ジシクロへキシルメタンジイソシアネート100部、ペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネート)93部、及び構造式(A)で表される近赤外線吸収剤0.095部とジブチル錫ジクロライド0.58部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々にに昇温しながら24時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得ら

れた樹脂の吸収波長は1000~1100nmであっ た。

【0045】実施例4

ノルボルナンビス (イソシアナトメチル) 100部、ペンタエリスリトールテトラキス (3-メルカプトプロピオネート) 119部、及び下記の構造式 (B)

[0046]

【化5】

で表される近赤外線吸収剤 0.055部とジブチル錫ジクロライド 0.22部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々に昇温しながら24時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得られた樹脂の吸収波長は1000~1150であった。

【0047】実施例5

トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート100部、ペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネート)116部、及び構造式(B)で表される近赤外線吸収剤0.054部とジブチル錫ジクロライド

0.22部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々に昇温しながら24時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得られた樹脂の吸収波長は1000~1150であった。【0048】実施例6

ヘキサメチレンジイソシアネート100部、ペンタエリ スリトールテトラキス(3ーメルカプトプロピオネー

ト) 1 4 5 部、及び下記の構造式 (C)

[0049]

【化6】

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

で表される近赤外線吸収剤 0.061部とジブチル錫ジクロライド 0.12部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々に昇温しながら24時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得られた樹脂の吸収液長は950~1100であった。

【0050】実施例7~16

ヘキサメチレンジイソシアネート100部、ペンタエリ スリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネー ト)145部、及び構造式(D)~(M)で表される近赤外線吸収剤0.061部とジプチル錫ジクロライド0.12部を混合し脱泡して均一溶液とした後、離型処理を施したガラスモールドとガスケットからなるモールド型に注入した。次いで、30℃から130℃まで徐々に昇温しながら24時間かけて加熱硬化させた。重合終了後、冷却して、重合体をモールドより取り出した。得られた樹脂の吸収波長はいずれも950~1100nm付近であった。結果を第1表に示す。

[0051]

【表1】

第1表

実施例	近赤外線吸収剤	吸収波長 (nm)
7 (D)	$C_{2H_{5} \atop C_{2H_{5}}} N = C_{2H_{5} \atop C_{2H_{5}}} C_{2H_{5}}$	950~ 1050
8 (E)	CH ₃ N CH ₃ S Ni S O O	1000~
9 (F)	$\begin{array}{c c} \text{MeO} & \\ \hline \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \\ \text{N} & \begin{array}{c c} \text{S} \\ \text{S} \\ \end{array} \\ \text{N} & \begin{array}{c c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \end{array} \\ \text{OMe} \end{array}$	1000~
1 0 (G)	MeO OMe S Ni S OMe CH ₃ N OMe CH ₃ N OMe OMe OMe	1000~ 1050
1 1 (H)	$\begin{array}{c c} Cl & & & \\ \hline \\ Cl & & & \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \end{array} \\ Ni & & S \\ \hline \\ Cl \\ S & & \\ \\ Cl \\ \end{array}$	950~ 1050

[0052]

【表2】

第1表 (続き)

実施例	近赤外線吸収剤	吸収波長 (nm)
12 (1)	CH ₃ S S Ni S Ni CH ₃ SCH ₃	1000~
13 (J)	CH ₃ N S Fe S N CH ₃	1000~
1 4 (K)	CH ₃ N S Co S O N CH ₃ CH ₃ N CH ₃	1 0 0 0 ~ 1 1 0 0
1 5 (L)		1000~ 1100
1 6 (M)	CH ₃ N S Cu S O N CH ₃ CH ₃ N S S O N CH ₃	1000~

[0053]

【発明の効果】本発明により、1000~1100nmの光を効果的に吸収する、近赤外線吸収ウレタン樹脂を得る事が出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた樹脂の吸収スペクトルである。

